port system that integrate the information obtained from test analyzers in the central laboratory and wards, which must be connected and operated with existing Hospital Information System. Extreme care should be paid for the security of patients' information and the countermeasure against system collapse.

K　Dedicated refrigerators／freezers for storing blood products (including autologous blood) and hematopoietic stem cells should be equipped with a system that can record and monitor the temperature both inside and outside, according to Blood Product Storage Management Manual issued by the Ministry of Health, Labor and Welfare.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　7 May, 2019

⑹　Contact point for the notice : Hiroaki Ouchi, Procurement Section, Accounting Division, the University of Tokyo Hospital, 7—3—1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113—8655 Japan, TEL 03—5800—8616

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成31年3月18日

国立大学法人島根大学長　服部　泰直

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　32

○第4号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量　集束イオンビーム走査型電子顕微鏡　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成31年度3月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件　本装置は、高分解能走査型電子顕微鏡に元素分析・結晶方位解析とそれらのマッピング機能及び超精密試料加工・観察リンクシステムを付加して構成される。

A　高分解能走査型電子顕微鏡本体の要求要件

a　電界放射型電子銃を有し、最高加速電圧が25kV以上であること。

b　高真空ドライ排気機構を有すること。

c　コンピュータ制御による光軸自動調整機能を有すること。

d　二次電子像及び反射電子像が得られ、二次電子像においては1nm以下の像分解能を有すること。

B　元素分析・結晶方位解析及びそれらのマッピング機能の要求要件

a　エネルギー分散特性X線分光（ＥＤＸ）による元素定量分析機能を有すること。

b　試料ドリフト補正機能を有すること。

c　後方散乱電子回折（ＥＢＳＤ）を利用した結晶方位解析及び相同定機能を有すること。

d　ＥＢＳＤ用検出器としてＣＭＯＳ型検出器を採用していること。

e　ＥＤＸ及びＥＢＳＤを同時使用したマッピング像を得られること。

C　超精密試料加工・観察リンクシステムの要求要件

a　集束イオンビームによる加工が可能であること。

b　コンピュータ制御によるナノスケールのパターン加工が可能であること。

c　二次電子像、反射電子像、元素マップ及び結晶方位マップを用いた連続切削画像を取得でき、50×50×50μm³以上の測定領域を確保することが可能であること。

d　加工による試料損傷を抑制または損傷部を除去する機能を有すること。

e　加工前後及び加工中の顕微モニターが可能であること。

f　加工された微小試料を的確かつ容易に搬送する機能を有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成31年4月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒690—8504 松江市西川津町1060 国立大学法人島根大学財務部経理・調達課 森山　洋　電話0852—32—6028

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成31年3月18日から平成31年4月18日まで。

⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成31年3月25日13時00分

⑵　開催場所　島根大学本部棟1階第一会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement : This system is composed of high-resolution scanning electron microscope equipped with the elemental analysis, the crystal orientation analysis, the mapping function, and the ultra-precise sample processing with observation linkage system.

A　Requirement of high resolution scanning electron microscope.

a　Field emission type electron gun, which can be operated with an accelerating voltage above 25kV.

b　High vacuum dry exhaust mechanism.

c　Automatic optical axis adjustment function by computer control.

d　Secondary electron image and backscattered electron image should be obtained. Regarding secondary electron imaging, image resolution being better than 1nm is required.

B　Requirement of the elemental analysis, and the crystal orientation analysis, and their mapping function.

a　Elemental quantitative analysis function by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) .

b　Sample drift correction function.

c　Crystal orientation analysis and phase identification function by electron backscatter diffraction (EBSD) .

d　Adoption a CMOS detector for the EBSD.

e　Mapping image should be obtained by simultaneous use of EDX and EBSD.

C　Requirement of ultra-precise sample processing with observation linkage system.

a　Processing by focused ion beam.

b　Pattern processing in nano-scale by computer control.

c　Continuous cutting image by using secondary electron image, backscattered electron image, element mapping and crystal orientation mapping, guaranteed measurement volume of over 50×50×50μm³.

d　Function to suppress sample damage by processing and／or to remove the damaged part.

e　Microscopic monitoring during and before and behind sample processing.

f　Function to transport processed micro samples precisely and easily.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　18 April, 2019

⑹　Contact point for the notice : Hiroshi Moriyama, Accounts Division, Finance Department, The National University Corporation Shimane University, 1060 Nishikawatsu-cho Matsue-shi 690—8504 Japan, TEL 0852—32—6028